## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2005年1月6日(06.01.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/001971 A1

(51) 国際特許分類7: H01M 8/02, 8/10, H01B 1/06, 13/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009454

(22) 国際出願日:

2004年6月28日(28.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-186613 2003年6月30日(30.06.2003)

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化学 工業株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒5418550 大阪府大阪市中央区北 浜四丁目5番33号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野殿 光紀 (NODONO, Mitsunori) [JP/JP]; 〒3050005 茨城県つく ば市天久保2-13-10-406 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.); 〒5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG. SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

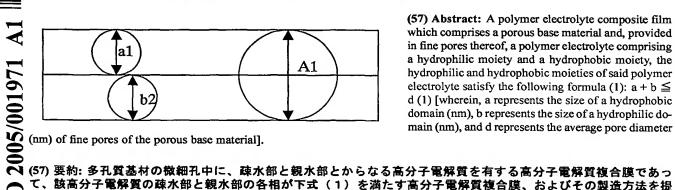
## 添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYMER ELECTROLYTE COMPOSITE FILM, METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND USE THEREOF

(54) 発明の名称: 高分子電解質複合膜、その製造方法及びその用途



て、該高分子電解質の疎水部と親水部の各相が下式 (1) を満たす高分子電解質複合膜、およびその製造方法を提 供する。 a+b≦d (1)(式中、aは疎水性ドメインの大きさ(nm)、bは親水性ドメインの大きさ(nm)、dは 多孔質基材の微細孔の平均細孔直径(nm)を表す。)